

東京応化工業株式会社 決算説明資料

-2013年3月期第2四半期決算-

2012年11月6日

目次

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 1.2013年3月期第2四半期連結決算 | p.2 |
| 2.2013年3月期通期連結決算予想 | p.12 |
| 3.半導体先端材料の深耕・拡大の推進
～韓国における子会社設立を決定～ | p.19 |

**2013年3月期第2四半期
連結決算**

業績概要

(百万円、%)

	2011/9	2012/9		
			増減	増減率
売上高	40,992	36,654	△4,337	△10.6
営業利益	4,107	4,271	+164	+4.0
経常利益	4,242	4,418	+176	+4.2
当期純利益	2,488	2,841	+352	+14.2

- 期中平均為替 (USドル) : 79.1円/ドル (2011/9) ⇒ 78.5円/ドル (2012/9)
- 売上高 : 装置事業の大幅減収により前年比10.6%の減収となったが、会社予想 (2012.5.9公表) に対して98.8%の進捗。
- 営業利益 : 装置事業の増益、材料事業での増益確保が奏功。前年比4.0%の増益。会社予想 (2012.5.9公表) に対して106.8%の進捗。

営業外損益・特別損益

(百万円)

	2011/9	2012/9	前年比
営業外損益	135	147	+12
(営業外収益)	(348)	(314)	△34
受取利息・配当金	125	126	0
持分法による投資利益	101	78	△22
(営業外費用)	(212)	(166)	△46
為替差損	67	36	△31
租税公課	112	102	△10
特別損益	△88	△300	△212
(特別利益)	(5)	(2)	△3
固定資産売却益	5	2	△3
(特別損失)	(93)	(303)	209
投資有価証券評価損	26	286	260
固定資産除去損	50	6	△44

事業別セグメントの業績

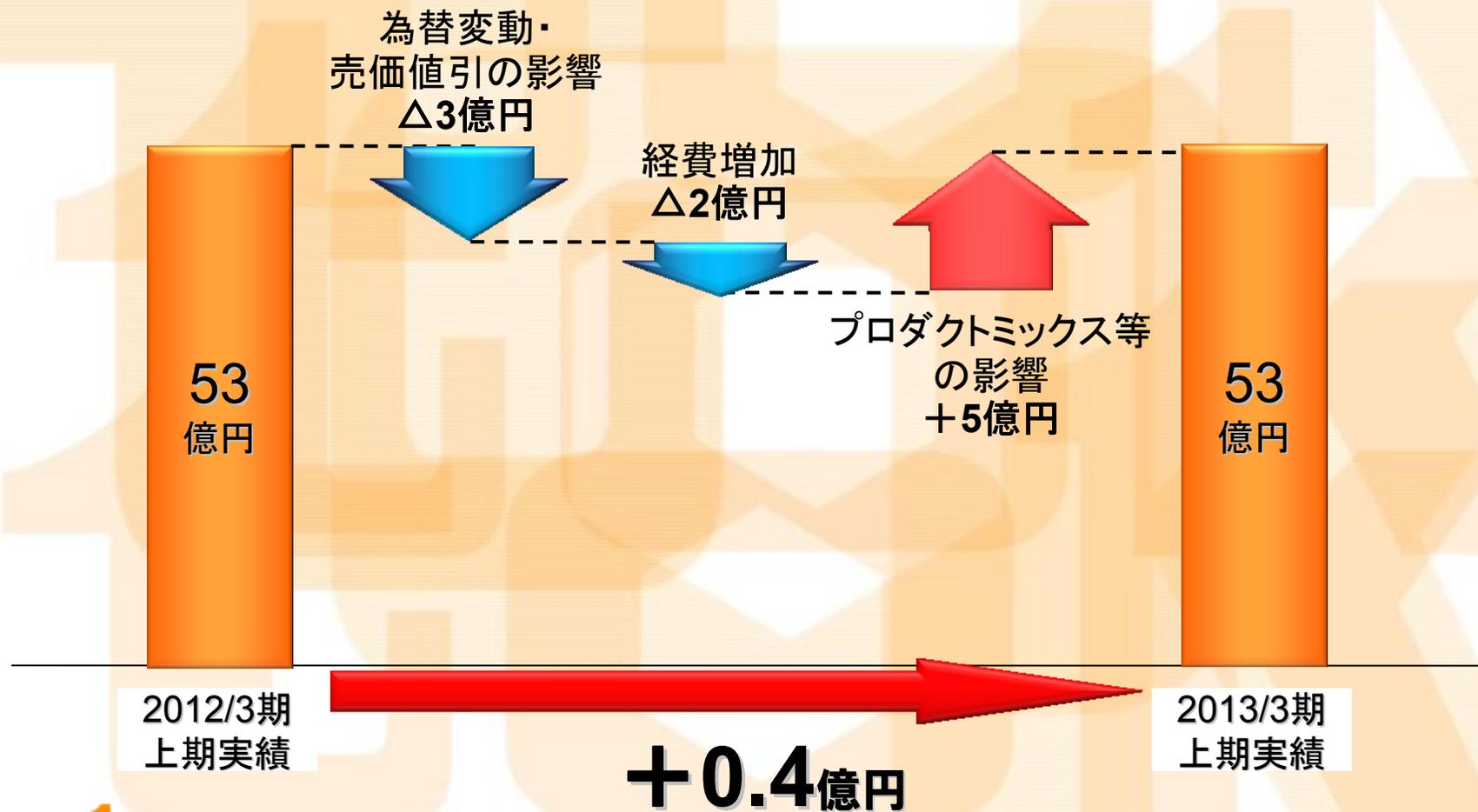
(百万円、%)

	2011/9	2012/9		
			増減	増減率
売上高	40,992	36,654	△4,337	△10.6
材料事業	34,497	33,742	△755	△2.2
エレクトロニクス機能材料	22,389	21,813	△575	△2.6
高純度化学薬品	11,747	11,689	△58	△0.5
その他	360	239	△121	△33.6
装置事業	6,494	2,912	△3,582	△55.2
営業利益	4,107	4,271	+164	+4.0
材料事業	5,283	5,325	+41	+0.8
装置事業	297	431	+133	+44.9
消去又は全社	△1,474	△1,485	△10	—

(注) 装置事業の売上は消去後の数字。2012/3期より受取技術料を売上高に計上(従来は営業外収益)。2012/3第2四半期累計(2011/9)について、受取技術料30百万円を売上高および営業利益に遡及反映。

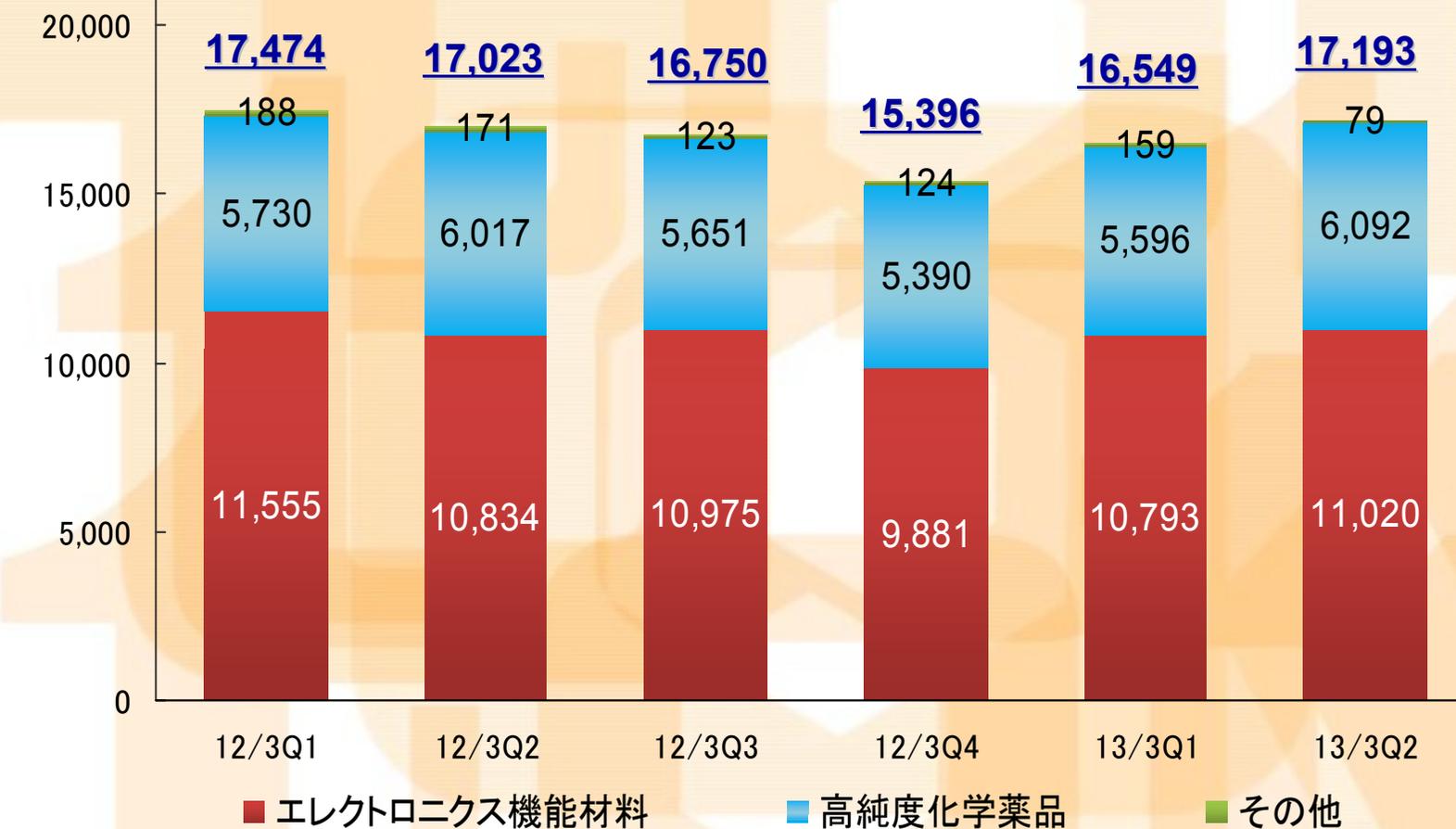
営業利益の増減内訳（材料事業）

2012年3月期上期実績 対 2013年3月期上期実績



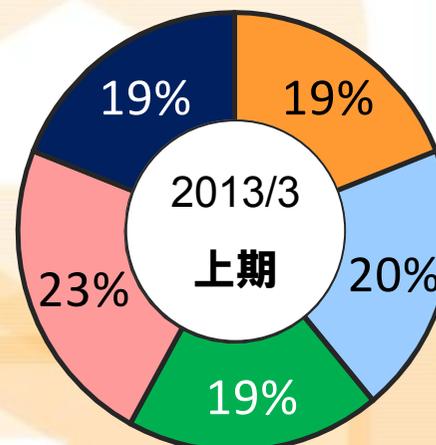
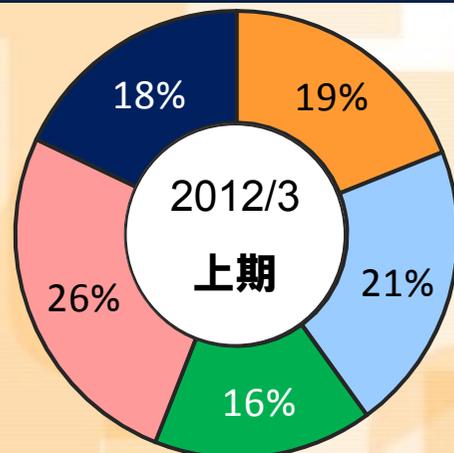
材料事業の売上内訳

売上高
(百万円)



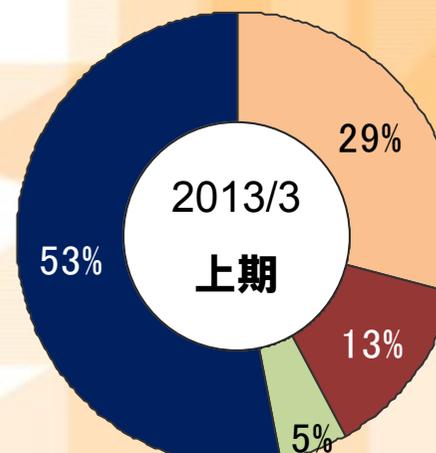
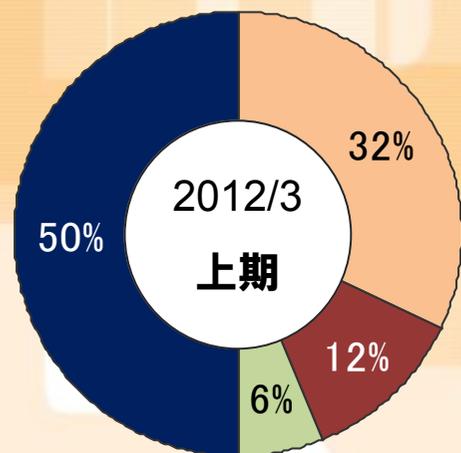
(ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



- g+i
- KrF
- ArF
- FPD
- その他

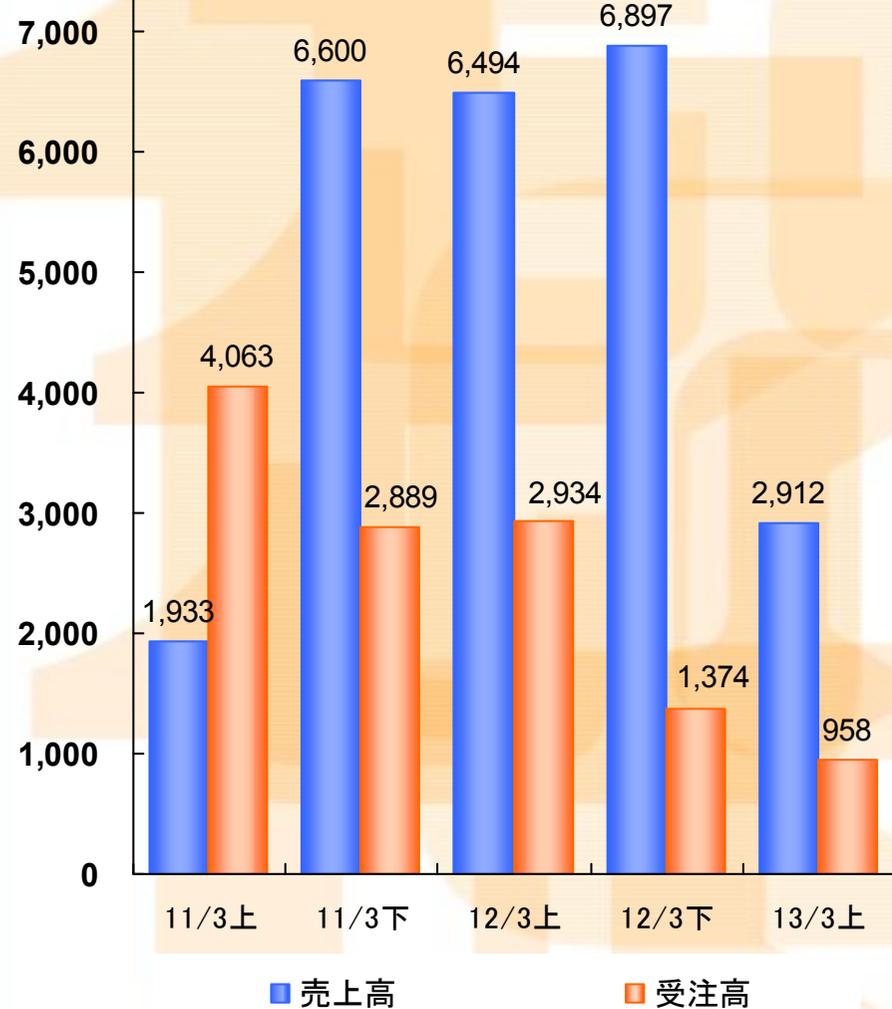
半導体フォトレジストの地域別売上構成



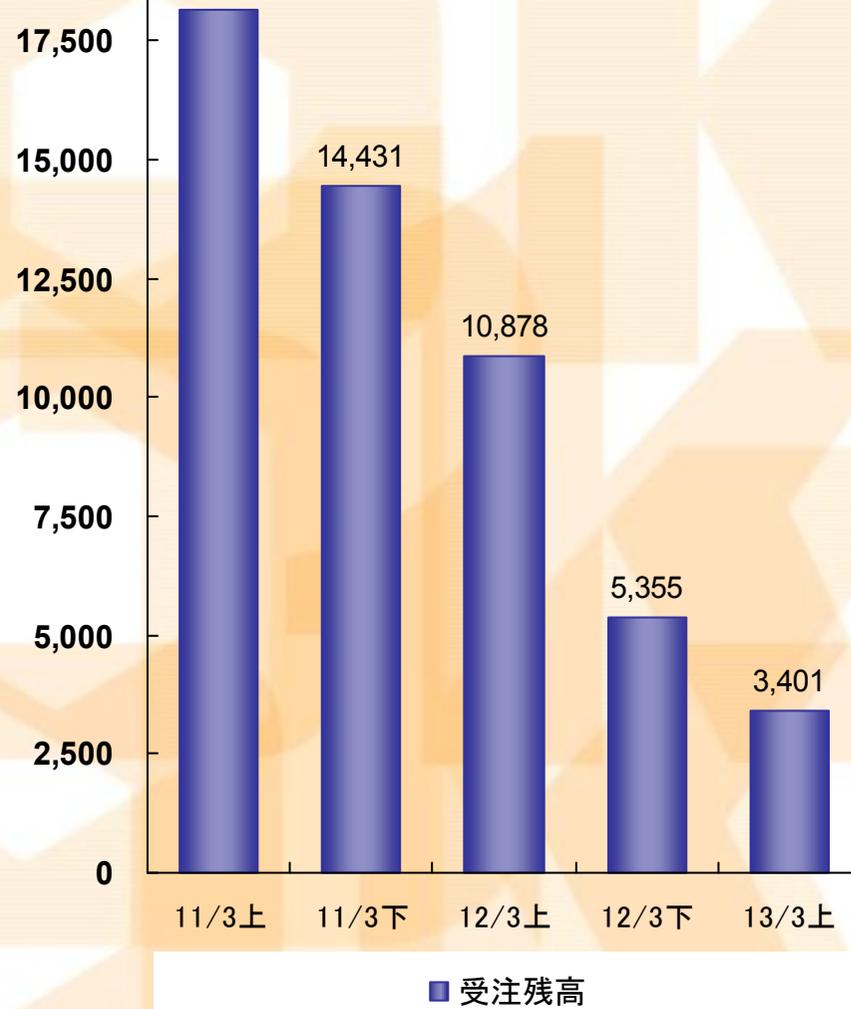
- 日本
- 北米
- 欧州
- アジア
- その他

装置事業の推移

売上高・受注高
(百万円)



期末受注残高
(百万円)



比較貸借対照表

(百万円)

	2012/9	12/3末比	
流動資産	84,120	+1,164	売上債権 $\Delta 1,248$ たな卸資産 $\Delta 817$ 未収金 $\Delta 216$
内、現金預金	53,299	+3,225	
有形固定資産	28,634	$\Delta 548$	建物及び構築物 $\Delta 360$ 機械装置 $\Delta 523$ 工具器具備品 +229 建設仮勘定 +101
無形固定資産	346	+100	
投資その他の資産	26,036	$\Delta 347$	投資有価証券 $\Delta 415$ 繰延税金資産 +208 長期貸付金 $\Delta 54$ 長期前払費用 $\Delta 53$
流動負債	15,079	$\Delta 1,484$	
買入債務	6,504	$\Delta 117$	
前受金	1,752	$\Delta 1,595$	
固定負債	2,585	$\Delta 27$	
純資産合計	121,471	+1,881	利益剰余金 +1,941 自己株式 +67 為替換算調整勘定 +178 その他有価証券評価差額金 $\Delta 285$
総資産	139,137	+369	

キャッシュフロー

(百万円)

	2011/9	2012/9
営業キャッシュフロー	+5,366	+5,930
税金等調整前当期純利益	+4,154	+4,117
減価償却費	+1,853	+1,800
貸倒引当金の増減(△)額	△55	△26
売上債権の増(△)減額	+1,399	+1,355
たな卸資産の増(△)減額	+3,405	+854
仕入債務の増減(△)額	△338	△147
前受金の増減(△)額	△4,668	△1,595
法人税等の支払い	△564	△618
投資キャッシュフロー	△11,985	+1,254
財務キャッシュフロー	△1,039	△1,109
換算差額	+22	+45
現金及び現金同等物の増減額	△7,634	+6,120

装置事業の検収促進

主な内訳

長期預金の純増預入 △4,500
有形固定資産の取得 △1,317
長期性預金の払戻収入 +6,500

主な内訳

配当金の支払 △1,116
(含む少数株主)

**2013年3月期通期
連結決算予想**

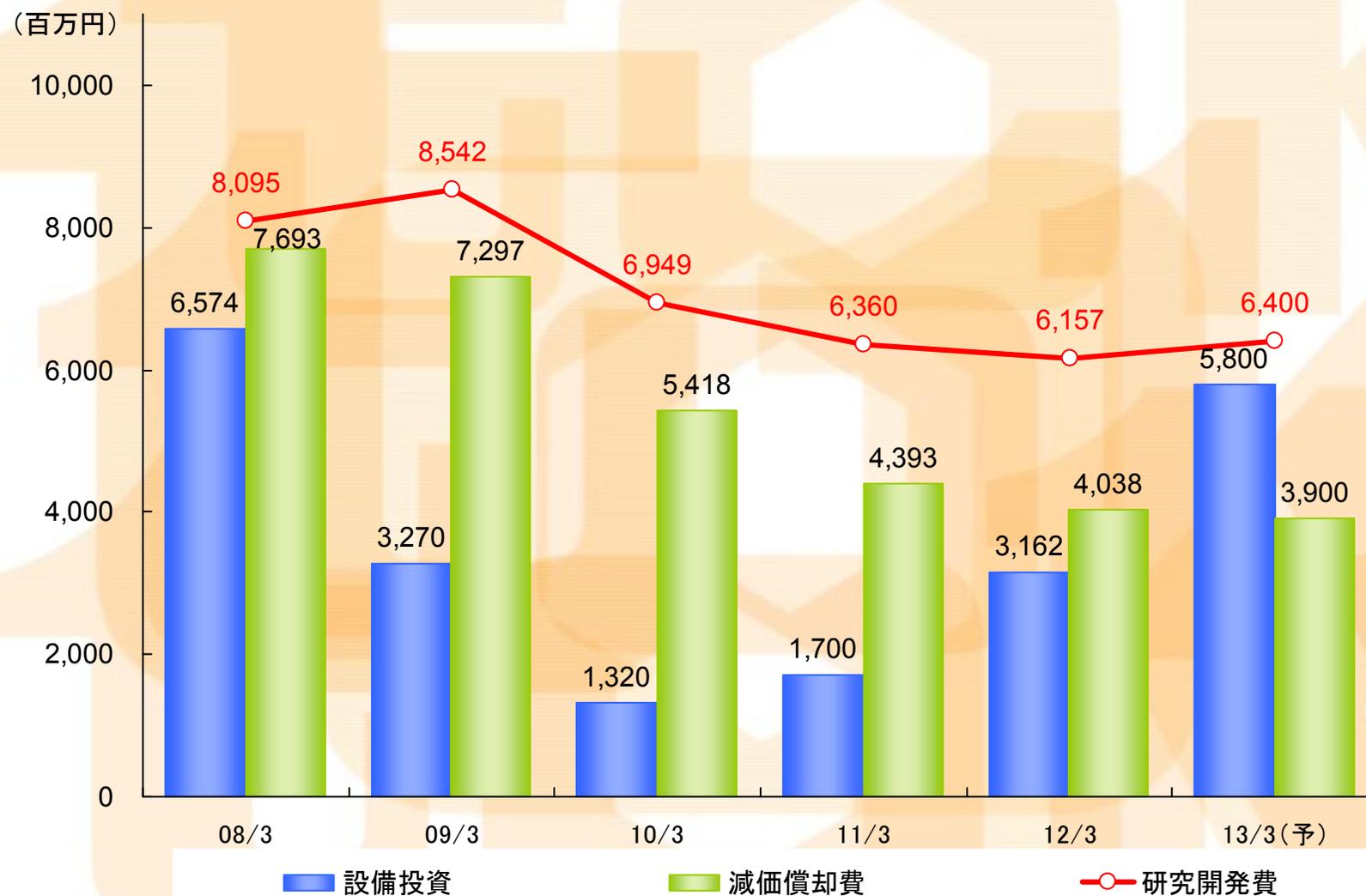
業績予想概要（通期）

（百万円、％）

	2012/3 実績	2013/3予想	
		増減	増減率
売上高	80,037	75,900	△4,137 △5.2
営業利益	6,102	8,000	+1,897 +31.1
経常利益	6,836	8,500	+1,663 +24.3
当期純利益	3,818	5,400	+1,581 +41.4

- 為替前提(US^{ドル}): 78.2円/^{ドル}(2012/3通期) ⇒ 80.0円/^{ドル}(2013/3下期)
- 売上高 : 材料事業は下期増収に転じるが、装置事業の上期減収の影響が残り、減収。下期見通しの変更により期初予想比600百万円減収。
- 営業利益: 装置事業は下期減益。期初予想値を300百万円下回る水準だが、材料事業の利益拡大により前年比+31.1%増益を確保。

設備投資・減価償却・研究開発



事業別セグメント業績予想

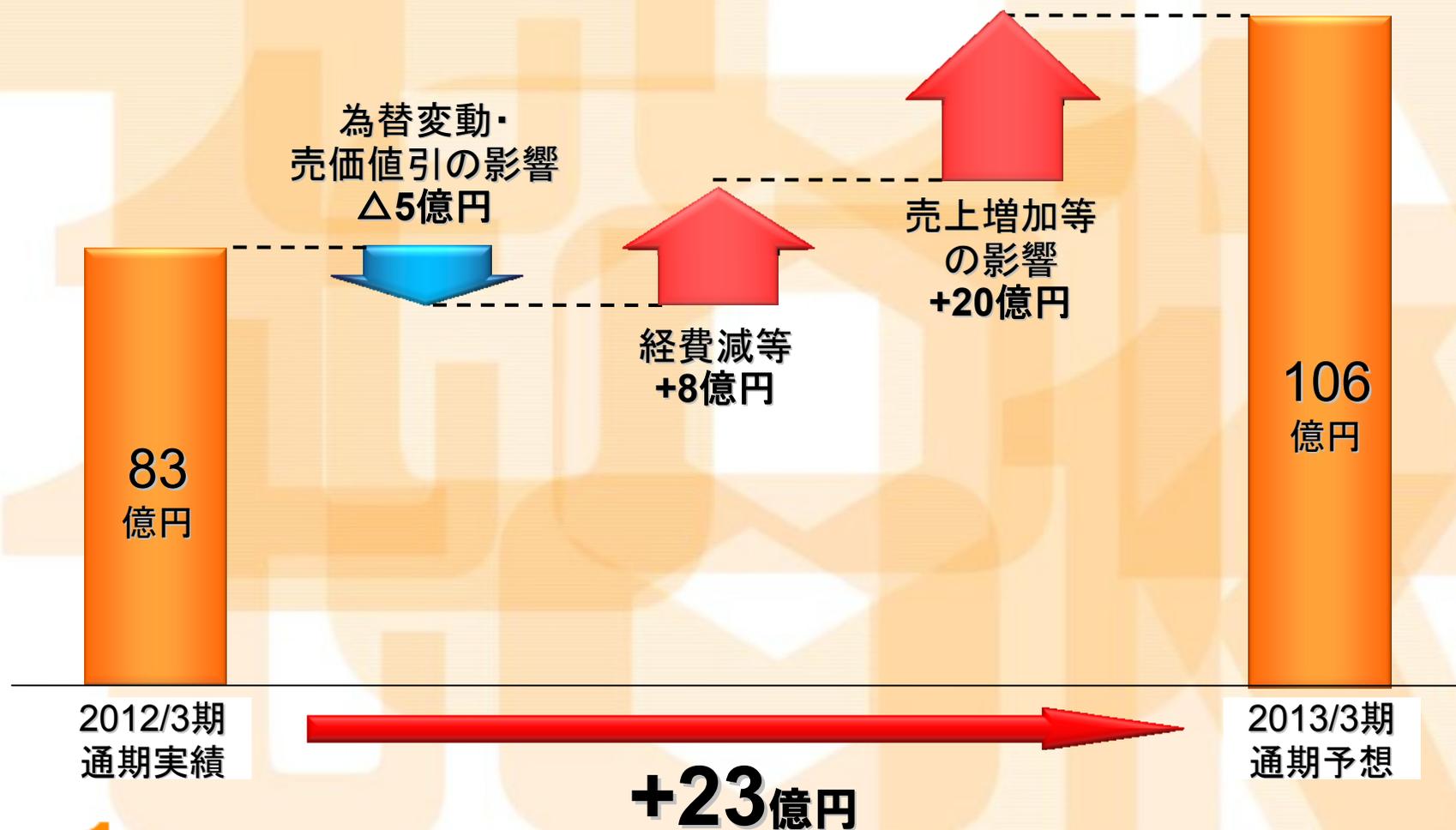
(百万円、%)

	2012/3 通期実績	2013/3通期予想	
		増減	増減率
売上高	80,037	75,900	△4,137 △5.2
材料事業	66,644	69,000	+2,355 +3.5
エレクトロニクス機能材料	43,246	43,800	+553 +1.3
高純度化学薬品	22,789	24,700	+1,910 +8.4
その他	609	500	△109 △17.9
装置事業	13,392	6,900	△6,492 △48.5
営業利益	6,102	8,000	+1,897 +31.1
材料事業	8,303	10,600	+2,296 +27.7
装置事業	908	400	△508 △56.0
消去又は全社	△3,108	△3,000	+108 -

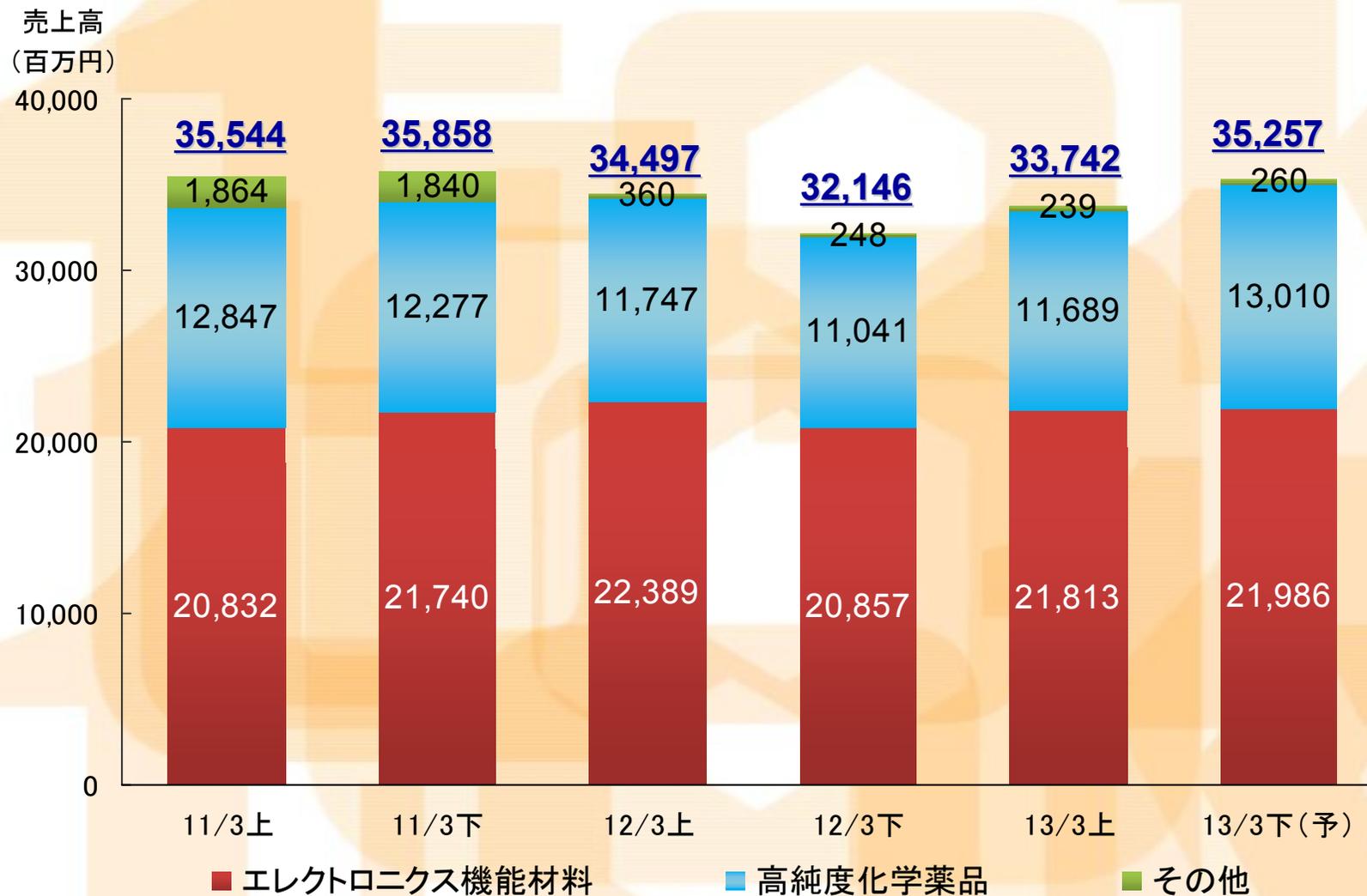
(注) 装置事業の売上は消去後の数字

営業利益の増減内訳（材料事業）

2012年3月期実績 対 2013年3月期予想



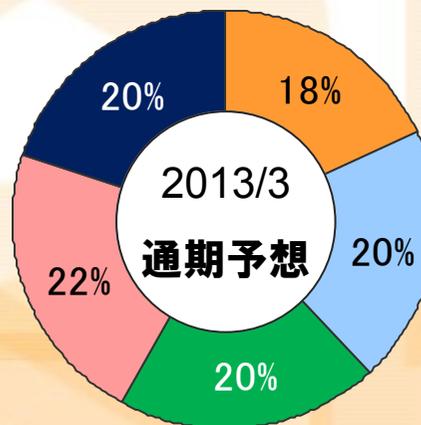
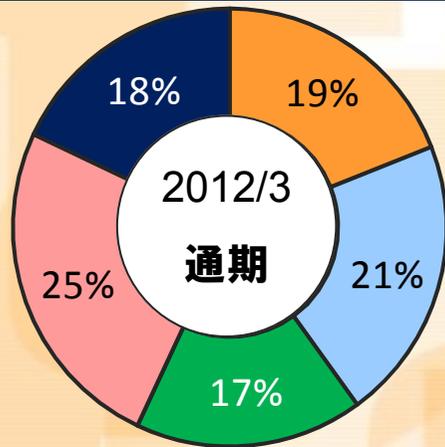
材料事業の売上内訳（予想）



(注) 印刷材料事業の売上高はその他に含む。印刷材料事業は2011年3月1日付けにて譲渡。

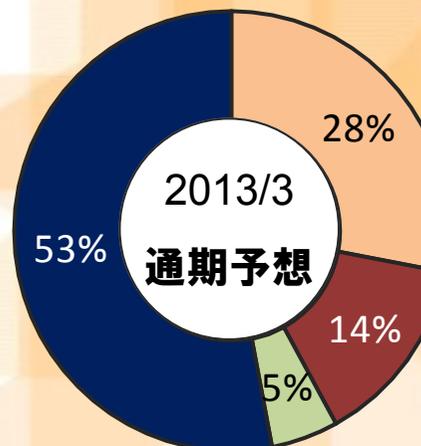
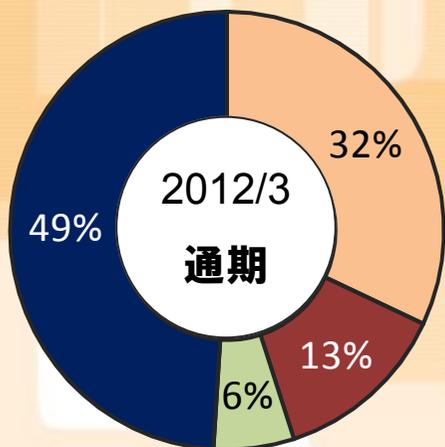
(ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



- g+i
- KrF
- ArF
- FPD
- その他

半導体フォトレジストの地域別売上構成



- 日本
- 北米
- 欧州
- アジア
- その他

半導体先端材料の深耕・拡大の推進

～韓国における子会社設立を決定～

2013年3月期の重点項目

「新生東京応化」の構築に向け加速



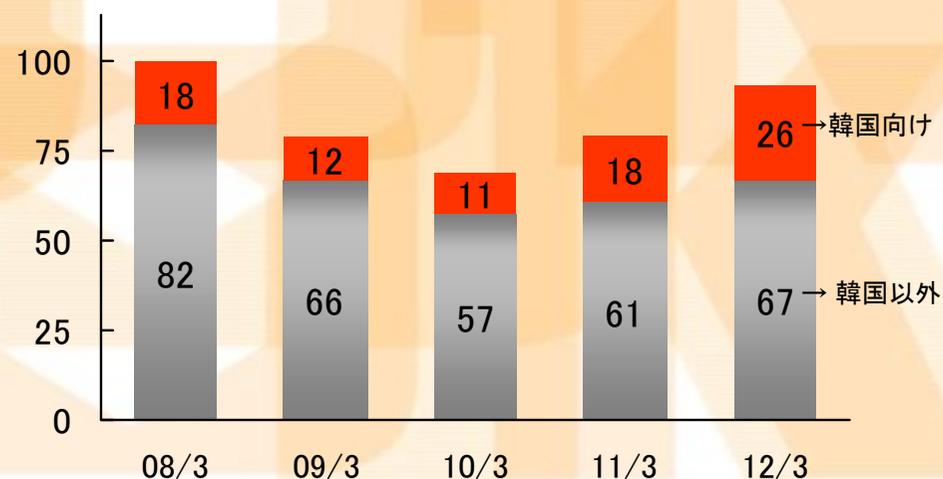
- 半導体先端材料の深耕・拡大の推進
- 既存技術の多用途展開
⇒光学関連材料等のマーケティング
- 新たなコア技術の開発・新事業の創出
⇒環境・エネルギー分野でのマーケティング等
- TSV主導による装置事業の推進
- 新・中期計画の策定着手

韓国における子会社の設立

米国、台湾、中国、韓国と成長市場に進出。
2012年8月、半導体用フォトレジストの現地生産を決定。

設立	会社名	所在地	製造品目	議決権所有割合
1987年	トウキョウ・オーカ・コウギョウ・アメリカ・インコーポレーテッド	米国	高純度化学薬品、i線フォトレジスト	100.0%
1998年	台湾東應化股份有限公司	台湾	高純度化学薬品	70.0%
2004年	長春應化(常熟)有限公司	中国	高純度化学薬品	51.0%
2005年	コテム・カンパニー・リミテッド(持分法適用関連会社)	韓国	TFTレジスト	30.0%
2012年	TOK先端材料株式会社	韓国	半導体用フォトレジスト (ArF、KrF)	90.0%

■ 当社半導体フォトレジスト事業の売上推移(ArF、KrF合計)



(注)08/3期のArF及びKrFの売上合計額を100として指数化。

「TOK尖端材料株式会社」の特長

TOK初の**研究開発機能**を持つ海外製造拠点

■ 「TOK尖端材料株式会社」の特長

- **製造品目：半導体先端材料を主体に製造**
⇒KrF、ArF（液浸）がメイン
- **製造能力：今後の需要増加に十分対応可能な能力**
⇒現行主力の郡山工場の約半分
- **研究開発：海外現地法人による「Face to Face」対応**
⇒ArF液浸露光機を装備



半導体先端材料の強固な基盤構築に向けて

半導体先端材料に関する当社認識

- ArF液浸レジスト等の微細加工技術の進化は続く。
- ArFレジスト市場における最終的なポジショニングは、1X世代の優劣により決定。
- EUVレジストは業界をリードする各社との関係強化の上では重要なテーマ。適正なコスト管理の下での研究開発が必要。



<韓国における子会社の設立>

成長力があり、イノベーティブな市場での拠点構築



コア事業として半導体先端材料の強固な基盤構築

- 1X世代における強固なポジショニングの確立
- ArF液浸レジスト等における更なるシェア獲得
- EUVレジスト開発の加速・アドバンテージの確保

<http://www.tok.co.jp/>

(ご注意)

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。